



PROCESSO SELETIVO DO MESTRADO EM PROCESSOS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS

EDITAL N.º 12/2018 – PROPPEX – ALTERAÇÃO I

A ASSOCIAÇÃO PRÓ-ENSINO SUPERIOR EM NOVO HAMBURGO – ASPEUR, mantenedora da Universidade Feevale (Portaria n.º 346, de 10.03.2017, do MEC), com sede em Novo Hamburgo, neste Estado, na ERS-239, 2755, Bairro Vila Nova, 93525-075, inscrita no CNPJ sob n.º 91.693.531/0001-62, representada pela Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão da Universidade Feevale no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto da Universidade torna público a alteração no item DA INSCRIÇÃO no edital de **Processo Seletivo para fins de ingresso, em 2018/02, no Programa de Pós-Graduação em Processos e Manifestações Culturais, Curso de Mestrado Acadêmico**, ministrado nesta Instituição de Ensino Superior, recomendado pelo Ofício N.º 31-21/2009/CTC/CAAIV/CGAA/DAV/CAPES.

1. DA INSCRIÇÃO

...

ONDE SE LÊ:

As inscrições deverão ser efetuadas entre os dias **17 de abril e 04 de junho de 2018**, pela internet, por meio do site www.feevale.br/processos.

A documentação poderá ser entregue no setor de Atendimento Feevale, Câmpus II, de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h15min e sábados, das 8h às 12h, ou no setor de Atendimento Feevale, Câmpus I, de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h15min, **até o dia 04 de junho de 2018**, ou enviada via correio (SEDEX) para o endereço descrito abaixo, observada a data limite de **28 de maio de 2018** para a postagem.

LEIA-SE:

As inscrições deverão ser efetuadas entre os dias **17 de abril e 11 de junho de 2018**, pela internet, por meio do site www.feevale.br/processos.

A documentação poderá ser entregue no setor de Atendimento Feevale, Câmpus II, de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h15min e sábados, das 8h às 12h, ou no setor de Atendimento Feevale, Câmpus I, de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h15min, **até o dia 11 de junho de 2018**.

Novo Hamburgo, 30 de maio de 2018.

João Alcione Sganderla Figueiredo
Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão